

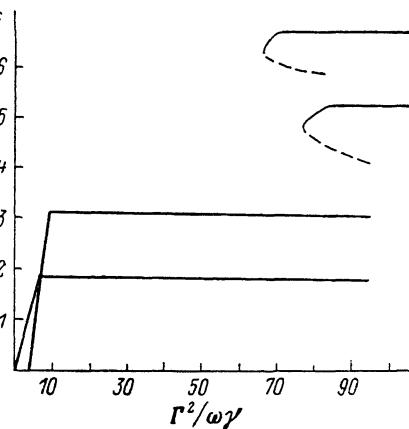
Отсюда следуют требования к стабилизации напряжения V , отвечающего за частоту джозефсоновской генерации Ω , а также ограничения на вариации в микрополосковой линии геометрических и физических параметров, которые определяют волновой вектор k .

Анализ системы уравнений (3)–(4) показывает, что волна линии усиливается, когда

$$\frac{n\Gamma^2}{\omega\gamma e_0^2} (1 - A_n(e_0))^{1/2} J_n(e_0) \begin{cases} \geq 1, & 0 \leq A_n \leq 1, \\ \leq -1, & -1 \leq A_n \leq 0. \end{cases} \quad (6)$$

По мере распространения волны изменение ее амплитуды прекращается и она достигает стационарных значений e_0^c , обращающих (6) в равенство. На рисунке представлены по две нижних ветви решения уравнения (6) для волны с несущей основной джозефсоновской частотой e_0^c $\omega = \Omega$ и ее субгармоникой $\omega = \Omega/2$. Отметим, что для каждой частоты при фиксированном факторе $\Gamma^2/\omega\gamma$ существует дискретный набор стационарных значений амплитуд e_0^c , с которыми волна может распространяться в длинном переходе. Устойчивым значениям e_0^c на рисунке соответствует сплошная линия, а неустойчивым — штриховая. Если начальная амплитуда лежит ниже штриховой линии, то ее значение по мере эволюции волны выходит на нижний устойчивый уровень, если выше — на верхний.

Существенно, что стационарное распространение волны на субгармонических джозефсоновых частотах ($n \geq 2$) возможно лишь при превышении фактором $\Gamma^2/\omega\gamma$ определенного порога. Так, для первой субгармонической частоты, когда $\omega = eV/h = ck(\mu\epsilon)^{-1/2}$, для характерных значений в полосковой линии $\omega = 2\pi \cdot 10^{11} \text{ с}^{-1}$, $\epsilon = 10$, $\gamma = 10^{-8} \text{ с}^{-1}$, $a \approx 10^{-4} \text{ см}$ стационарное распространение волны возможно лишь при плотности джозефсоновского тока $j_c \geq 0.6 \text{ mA/cm}^2$. Такие пороговые значения плотности туннельного сверхтока можно реализовать экспериментально, нанося туннельные контакты методом электронной литографии с интервалом, кратным длине волны.



Литература

- [1] Димитренко И. М., Янеон И. К. ЖЭТФ, 1965, т. 49, № 12, с. 1741—1746.
- [2] Солитоны в действии / Под ред. К. Лорена и Э. Скотта. М.: Мир, 1981. 185 с.
- [3] Алексеев А. Е., Булыжников И. Э. Квант. электр., 1984, т. 11, № 2, с. 334—338.

Московский физико-технический
институт
Долгопрудный

Поступило в Редакцию
12 ноября 1987 г.

УДК 772.99

Журнал технической физики, т. 58, в. 12, 1988

САМОУСИЛЕНИЕ ФАЗОВЫХ ГОЛОГРАММ В ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЙСЯ КОМПОЗИЦИИ

Э. С. Гюльназаров, Т. Н. Смирнова, Е. А. Тихонов

Процесс записи голограмм в регистрирующих материалах с откликом в реальном масштабе времени сопровождается самовоздействием записывающих световых пучков. Одно из проявлений указанного самовоздействия — самоусиление голограмм — было, предсказано в [1] и осуществлено в кристаллах LiNbO_3 в работе [2]. Дальнейшее развитие представлений об этом процессе в чистых и легированных кристаллах LiNbO_3 нашло отражение в цикле работ [3—5]. Самоусиление голографической записи наблюдалось также в аддитивно окрашенных кристаллах КBr и аморфных халькогенидах [6, 7].

В настоящей работе представлены результаты исследования самоусиления в новом регистрирующем материале — жидкой фотополимеризующейся композиции ФПК-488 [8].

Регистрирующий слой ФПК-488 требуемой толщины формируется между стеклянными подложками. Обеспечивая запись фазовых голограмм в реальном масштабе времени с дифракционной эффективностью η до 85 %, пространственной частотой до 4000 мкм^{-1} и долговременной фотохимической стабильностью, ФПК-488 является перспективным материалом для создания голографических оптических элементов.

Самоусиление в ФПК-488 исследовалось при брэгговском и небрэгговском считывании пропускающих голограмм в зависимости от начальной дифракционной эффективности «затравочной» решетки η_0 . Одновременно недеструктивное считывание решетки осуществлялось пучком Не—Не-лазера ($\lambda_c=632.8 \text{ нм}$). Запись «затравочной» решетки осуществлялась в по-путных пучках Не—Cd-лазера ($\lambda_s=441.6 \text{ нм}$) равной интенсивности ($I_R=I_S \approx 1 \text{ мВт/см}^2$) при симметричном падении на регистрирующий слой. При небрэгговском считывании пучок

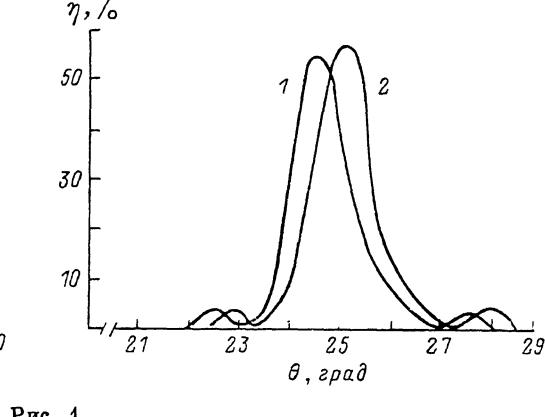
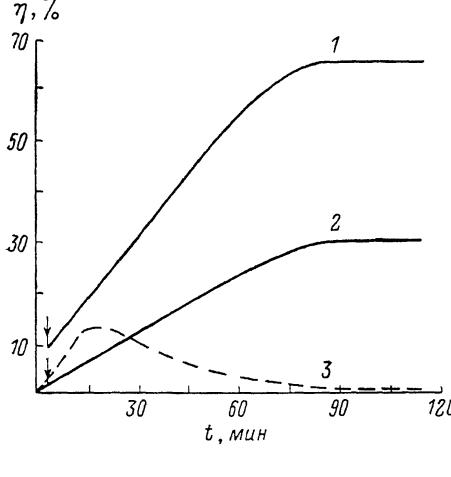


Рис. 1.

1, 2 — самоусиление при брэгговском, 3 — при небрэгговском считывании. Стрелками указан момент прерывания двухпучковой записи. λ , нм: 1 — 441.6, 2 — 632.8.

Рис. 2.

1 — угловая селективность решеток, записанных двумя пучками, 2 — в режиме самоусиления. $\lambda_c=632.8 \text{ нм}$, $d=20 \text{ мкм}$, $N=1260 \text{ мм}^{-1}$.

направлялся перпендикулярно к поверхности слоя. Для выбранных условий записи (толщина слоя $d=20 \text{ мкм}$, пространственная частота решетки $N=1260 \text{ мм}^{-1}$) решетка является объемной с угловой селективностью $1.2-1.4^\circ$. На рис. 1 показаны характерные кинетические кривые самоусиления $\eta(t, I=\text{const})$. Двухпучковая запись в данном случае прерывалась при $\eta_0=3\%$ для $\lambda_c=632.8 \text{ нм}$. В дальнейшем при облучении решетки одним из записывающих пучков наблюдался монотонный рост $\eta(t)$ для обеих λ_c с выходом на стационарное значение. Установление стационарного значения η означает полное завершение процесса полимеризации светочувствительного слоя, в результате чего в нем формируется стабильная решетка. Самоусиление эквивалентно для обоих брэгговских пучков.

На рис. 1 показана также $\eta(t)$ при небрэгговском считывании голограммы. Начальный рост η после прерывания двухпучковой записи обусловлен темновым развитием процесса формирования решетки [9], который подавляется однородной засветкой слоя, о чем свидетельствует последующий спад η .

При изменении η_0 «затравочной» решетки характер кинетических кривых самоусиления сохраняется, изменяются лишь конечное значение дифракционной эффективности (η_e), коэффициент самоусиления ($\alpha=\eta_e/\eta_0$) и экспозиция, требуемая для достижения стационарного значения η_e . В таблице приведены указанные выше параметры для двух λ_c , откуда видно, что α возрастает с уменьшением η_0 , но при этом уменьшается η_e и растет экспозиция. При используемой интенсивности записывающих пучков, стартуя с $\eta_0=1\%$, можно получить решетку в режиме самоусиления с максимальным значением $\eta_e=83\%$ при $\lambda_c=441.6 \text{ нм}$ и $\eta_e=55\%$ при $\lambda_c=632.8 \text{ нм}$.

$\lambda_c = 441.6 \text{ нм}$		$\lambda_c = 632.8 \text{ нм}$	
$\eta_0, \%$	α	$\eta_0, \%$	α
37.0 ± 3.7	1.9 ± 0.3	20.0 ± 2.0	2.0 ± 0.3
2.5 ± 0.2	34.0 ± 4.8	1.0 ± 0.1	48.0 ± 6.7
1.7 ± 0.2	48.2 ± 6.7	0.7 ± 0.1	68.3 ± 12.3
0.20 ± 0.03	145.0 ± 26.1	0.06 ± 0.02	180.0 ± 64.8

Сравнение криевых угловой селективности $\eta(\theta)$ решеток, записанных двумя пучками в режиме самоусиления, показало, что в последнем случае в среде формируется решетка с наклонными по отношению к поверхности штрихами (рис. 2). Угол наклона изофазных плоскостей решетки с уменьшением η_0 возрастает примерно от 0.1° при $\eta_0=19\%$ до 0.3° при $\eta_0=0.7\%$.

Измеренные кривые угловой селективности для решеток, записанных двумя пучками, несколько уже в сравнении с рассчитанными по формулам Когельника [8]. Формы кривых $\eta(\theta)$ решеток, записанных при самоусиении, для всех η_0 совпадают с $\eta(\theta)$ для решеток, записанных двумя пучками. Уширение брэгговского пика и отличия $\min \eta(\theta)$ от нуля не обнаружено, что свидетельствует о постоянстве глубины модуляции показателя преломления по толщине регистрирующего слоя [3].

Следует отметить, что η_0 на кинетических кривых самоусиения (рис. 1) занижены из-за наклона решетки в процессе записи. В таблице при вычислении α введена соответствующая поправка.

В соответствии с существующими представлениями об эффекте самоусиения в средах с локальным откликом в результате дифракциичитывающего брэгговского пучка на «затравочной» решетке формируется интерференционная картина, смешенная относительно нее по фазе на $\pi/2$ и записывающая новую решетку.

В связи с изменением контраста интерференционного поля по глубине слоя вклад «до-записываемой» решетки также возрастает по глубине слоя. Совместно с известными динамическими эффектами нестационарного преобразования пучков это приводит к наклону штрихов суммарной решетки. Наклон может быть скомпенсирован первоначальной ориентацией «затравочной» решетки. Уменьшение контраста интерференционного поля при уменьшении η_0 приводит к частичному стиранию «затравочной» решетки и соответствующему увеличению наклона штрихов.

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы.

- Обнаружено и исследовано голографическое усиление записи в однопучковом режиме в фотополимеризующейся регистрирующей среде.
- Максимальный коэффициент самоусиения в ФПК-488 существенно превышает измеренный для $\text{LiNbO}_3 : \text{Fe}$ (0.03 вес. %) и равный 50 и близок по величине к полученному для аморфных халькогенидных пленок (250).
- Режим самоусиения обеспечивает формирование в ФПК-488 однородных по глубине решеток с высокой дифракционной эффективностью и угловой селективностью в условиях сниженных требований к виброустойчивости голографической установки.

Литература

- [1] Staebler D. L., Amodei J. J. J. Appl. Phys., 1972, v. 43, N 3, p. 363—365.
- [2] Gaylord T. K., Rabson T. A., Tittel F. K. et al. J. Appl. Phys., 1973, v. 44, N 2, p. 896—897.
- [3] Марков В. Б., Одудов С. Г., Соскин М. С. Изв. АН СССР. Сер. физ., 1977, т. 41, № 4, с. 821—829.
- [4] Кухтарев Н. В. УФЖ, 1978, т. 23, № 12, с. 1948—1953.
- [5] Шварц К. К. Физика оптической записи в диэлектриках и полупроводниках. Рига: Зиннатне, 1986. 232 с.
- [6] Рейнфельде М. Я., Озолс А. О., Шварц К. К. Изв. АН ЛатвССР, 1986, № 3, с. 128—131.
- [7] Рейнфельде М. Я. Автореф. канд. дис. Саласпилс, 1986. 16 с.
- [8] Гульназаров Э. С., Смирнова Т. Н., Тихонов Е. А. ЖТФ, 1987, т. 57, № 5, с. 932—936.
- [9] Гульназаров Э. С., Смирнова Т. Н., Тихонов Е. А., Шпак М. Т. УФЖ, 1988, т. 33, № 1, с. 8—10.